【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成22年8月12日(2010.8.12)

【公表番号】特表2009-544987(P2009-544987A)
【公表日】平成21年12月17日(2009.12.17)
【年通号数】公開・登録公報2009-050
【出願番号】特願2009-520023(P2009-520023)
【国際特許分類】
Ｇ０２Ｆ　1/15　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０２Ｆ　1/15　５０２
Ｇ０２Ｆ　1/15　５０７

【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年6月17日(2010.6.17)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２２】
本発明のさらなる別の態様によれば、それは、上述されているような電気化学的素子を製造するための方法に関し、電気化学的素子の層のうちの少なくとも１つが、任意選択で磁場によりアシストされるカソードスパッタリングなど、真空を含む技術によって、熱蒸発もしくは電子ビームによりアシストされる蒸発によって、レーザアブレーションによって、任意選択でプラズマもしくはマイクロ波によりアシストされるＣＶＤによって、または大気圧技術によって、具体的には、ディップタイプ、スプレイコーティングもしくはローラコーティングの、具体的には、ゾル－ゲル合成を使用して層を付着することによって、付着される。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２４】
本発明の文脈においては、用語「下側の」導電性層は、基準として見なされるキャリア基板により近接して位置する導電性層を意味すると意図され、その導電性層上に、活性層（例えば、「全固体」エレクトロクロミックシステムにおけるすべての活性層）のうちの少なくとも一部が付着される。「上側の」導電性層は、他方の側に付着された導電性層である。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３４】
すべてのこれらの層は、磁場アシストのカソードスパッタリングによって付着された。変形形態としては、熱蒸発もしくは電子ビームによりアシストされる蒸発によって、レーザアブレーションによって、任意選択でプラズマによりもしくはマイクロ波によりアシス

トされるＣＶＤによって、または大気圧技術によって、具体的には、ディップタイプ、スプレイコーティングもしくはローラコーティングの、具体的には、ゾル－ゲル合成を使用して層を付着することによって得ることが可能になる。